

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年2月9日(09.02.2023)



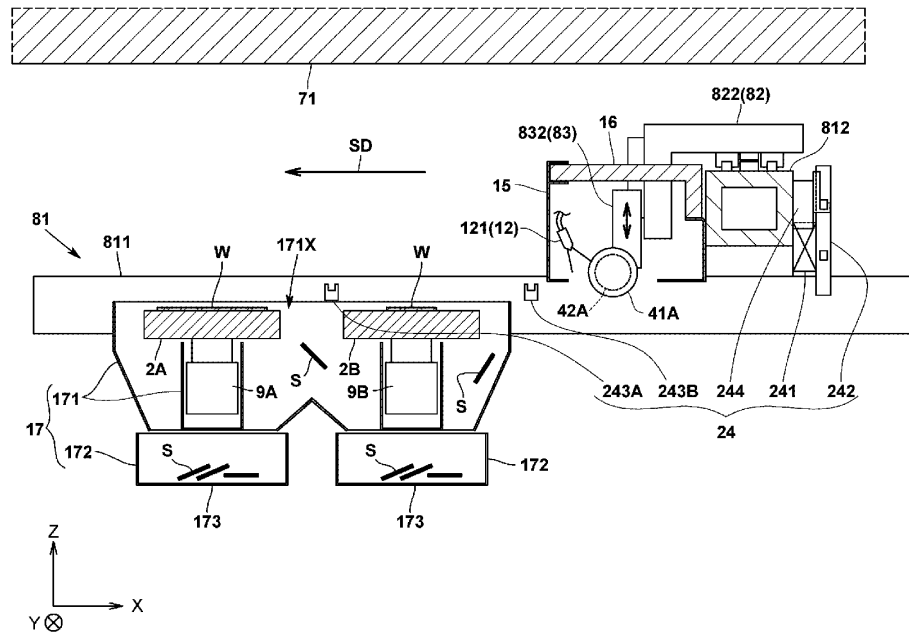
(10) 国際公開番号

WO 2023/013147 A1

- (51) 国際特許分類:
B23Q 7/04 (2006.01) B23Q 11/08 (2006.01)
B24B 27/06 (2006.01) B23Q 11/10 (2006.01)
B24B 55/02 (2006.01) B23Q 3/08 (2006.01)
B24B 55/06 (2006.01) B24B 41/06 (2012.01)
B23Q 11/00 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/013027
- (22) 国際出願日: 2022年3月22日(22.03.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-128234 2021年8月4日(04.08.2021) JP
- (71) 出願人: T O W A 株 式 会 社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 深井 元樹(FUKAI, Motoki); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 T O W A株式会社内 Kyoto (JP). 堀 聡子(HORI, Satoko); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 T O W A株式会社内 Kyoto (JP). 坂上 雄哉(SAKAUE, Yuya); 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地 T O W A株式会社内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 西村 竜平, 外(NISHIMURA, Ryuhei et al.); 〒6008441 京都府京都市下京区四条町347番地1 C U B E西烏丸9階 Kyoto (JP).

(54) Title: PROCESSING DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING PROCESSED ARTICLE

(54) 発明の名称: 加工装置、及び加工品の製造方法



(57) Abstract: The present invention simplifies device structure, reduces footprint, and prevents scattering of processing fluid. This processing device comprises: a processing table 2A, 2B for holding a sealed substrate W; a first holding mechanism 3 for holding the sealed substrate W to transport the sealed substrate W to the processing table 2A, 2B; a processing mechanism 4 for processing the sealed substrate W held on the processing table 2A, 2B; a transfer table 5 to which a plurality of products P are transferred; a second holding mechanism 6 for holding the plurality of products P to

[続葉有]

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

transport the plurality of products P from the processing table 2A, 2B to the transfer table 5; a transportation movement mechanism 7 having a common transfer shaft 71, extending along a direction in which the processing table 2A, 2B and the transfer table 5 are arranged, for moving the first holding mechanism 3 and the second holding mechanism 6; a processing movement mechanism 8 that, in a horizontal plane, moves the processing mechanism 4 in each of an X direction along the transfer shaft 71, and a Y direction orthogonal to the X direction; a processing fluid supply mechanism 12 that is moved together with the processing mechanism 4 by the processing movement mechanism 8, and sprays the processing fluid to the processing mechanism 4 from the front side in a processing-feed direction SD; and a processing fluid scattering prevention mechanism 24 that is provided on the rear side in the processing-feed direction SD with respect to the processing mechanism 4, covers the top of the processing table 2A, 2B from a position lower than a top surface of the processing table 2A, 2B, and prevents scattering of the processing fluid.

(57) 要約: 本発明は、装置構成を簡素化するとともに、フットプリントを低減しつつ、加工液の飛散を防止するものであり、封止済基板Wを保持する加工テーブル2A、2Bと、封止済基板Wを加工テーブル2A、2Bに搬送するために封止済基板Wを保持する第1保持機構3と、加工テーブル2A、2Bに保持された封止済基板Wを加工する加工機構4と、複数の製品Pが移される移載テーブル5と、複数の製品Pを加工テーブル2A、2Bから移載テーブル5に搬送するために複数の製品Pを保持する第2保持機構6と、加工テーブル2A、2B及び移載テーブル5の配列方向に沿って延び、第1保持機構3及び第2保持機構6を移動させるための共通のトランスファ軸71を有する搬送用移動機構7と、加工機構4を水平面においてトランスファ軸71に沿ったX方向及びX方向に直交するY方向それぞれに移動させる加工用移動機構8と、加工用移動機構8により加工機構4とともに移動し、加工送り方向SDの前側から加工機構4に加工液を噴射する加工液供給機構12と、加工機構4に対して加工送り方向SDの後側に設けられるとともに、加工テーブル2A、2Bの上面よりも下側の位置から上方を覆い、加工液の飛散を防止する加工液飛散防止機構24とを備える。